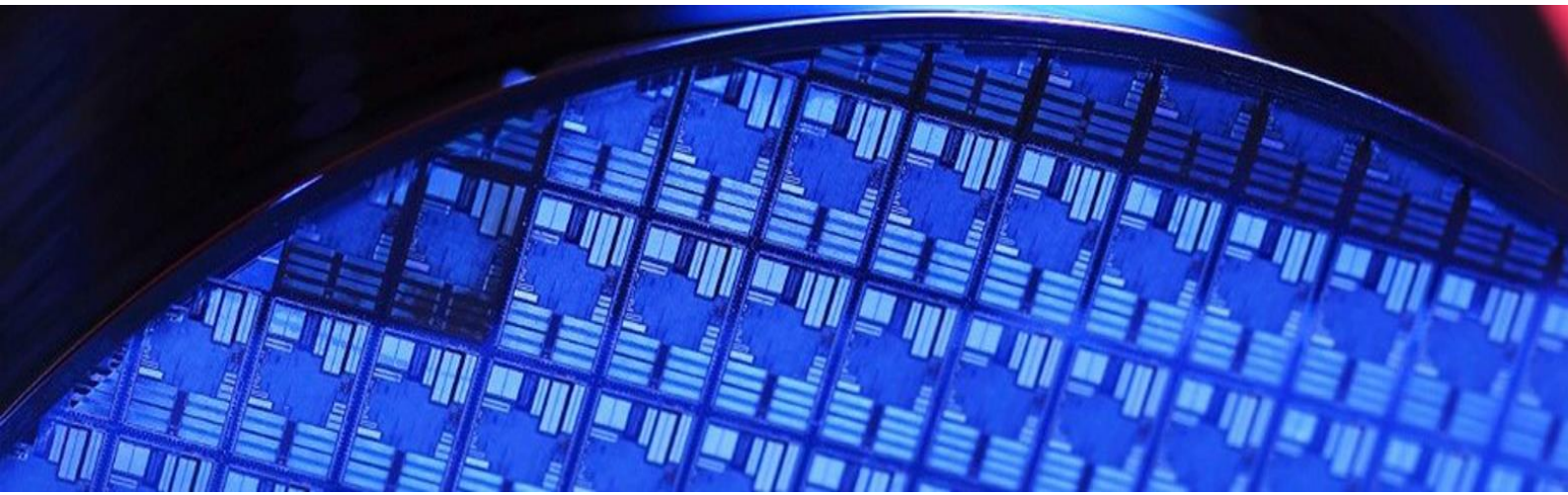


Gemch

溅射靶材
Sputter Target

研发
Development

解决方案
Technical Solutions



基迈克材料科技
半导体溅射靶材产品目录

概览 | OVERVIEW

基迈克材料科技采用分别基于粉末冶金技术和熔铸冶金技术 Powdmet™ 和 Caspa™ 工艺生产用于半导体产业相关的高性能溅射靶材。采用 Powdmet™ 和 Caspa™ 技术所制备的靶材具备高纯度、细微且均匀的晶粒等优异性能。

通过对材料本体性能的持续稳定控制和不断提升是基迈克向客户提供优质稳定靶材的可靠保障。

Powdmet™ 和 Caspa™ 技术是基迈克技术团队通过多年的研发所获得的成果,是将粉末冶金技术和熔铸冶金技术应用于高性能半导体溅射靶材制造的突破性成果的体现。



高纯铜靶材

应用市场 | APPLICATION MARKET

基迈克生产的高性能溅射靶材可以运用于半导体产业相关的多个领域包括:

- LED
- MEMS
- 功率器件
- 先进封装

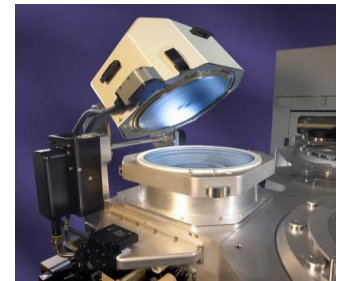
竞争优势 | COMPETITIVE ADVANTAGE

- 高度柔性化生产
- 快速响应客户需求
- 丰富的材料组分选择
- 批次间产品的高度稳定性

配置 | CONFIGURATION

基迈克可以提供与目前主流半导体 PVD 机台匹配的溅射靶材, 包括

- AMAT
- MRC
- Novellus
- Oerlikon
- ULVAC



产品 | PRODUCT

我们可以提供及其广泛的材料选择, 根据客户要求提供单一元素或多种组分的溅射靶材, 包括特殊陶瓷、金属基复合材料(MMC)以及陶瓷基复合材料(CMC), 典型产品有:

- Al
- AlCu
- AlSiCu
- Cu
- Ti
- Ta
- W
- Co
- WTi

高性能溅射靶材生产商, 基迈克材料科技是您可以信赖的半导体靶材供应商和行业合作伙伴。

关于更多产品信息, 请联系基迈克销售人员
Semi@gemch.com

关于基迈克

基迈克材料科技致力于为薄膜沉积应用提供高性能薄膜材料以及周边产品和服务。我们以先进材料技术驱动业务发展，通过持续不断的技术创新为各个业务领域的客户提供高附加值的产品，在立足于满足客户当前需求的同时更关注来自未来的挑战。欲了解更多信息，请访问：www.gemch.com

ISO9001 认证溅射靶材供应商

基迈克材料科技(苏州)有限公司
苏州汾湖高新技术产业开发区汾杨路 100 号